(19)日本国特許庁(JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

# 特開平6-157622

(43)公開日 平成6年(1994)6月7日

(51) Int.Cl.<sup>5</sup>

識別記号 MDN 庁内整理番号 7442-4 J FΙ

技術表示箇所

C 0 8 F 2/50 G 0 3 F 7/028

7/029

審査請求 未請求 請求項の数1(全 5 頁)

(21)出願番号

特願平4-339688

(71)出願人 000222118

東洋インキ製造株式会社

(22)出願日

平成4年(1992)11月26日

東京都中央区京橋2丁目3番13号

(72)発明者 田中 穂積

東京都中央区京橋二丁目3番13号東洋イン

キ製造株式会社内

# (54) 【発明の名称】 感光性組成物

### (57)【要約】

【目的】光カチオン重合性モノマー光ラジカル重合性モノマー、光カチオン重合性モノマーを用いて、紫外線(200~450) nmを照射することによりハイブリッドな重合体あるいは架橋化合物を提供する。

【構成】カチオン重合性不飽和ビニル化合物(A)、重合性不飽和ビニル化合物(B)、オニウム塩化合物(C)、及び光重合開始剤(D)からなる200~450nmの紫外線により光重合することを特徴とする感光性組成物。

【効果】 200~450 nmの紫外線を照射することにより、重合あるいは硬化反応を起こす。このことから、新しいハイブリッドタイプの紫外線感光性材料を簡便に得ることができる。

1

# 【特許請求の範囲】

【請求項1】 カチオン重合性不飽和ビニル化合物 (A)、重合性不飽和ビニル化合物 (B)、オニウム塩化合物 (C)、及び光重合開始剤 (D)からなる200~450nmの紫外線により光重合することを特徴とする感光性組成物。

# 【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、紫外線(200~450nm)で重合する複合系感光組成物に関するものであ 10 る。さらに詳しくは紫外線照射により、オニウム塩化合物と可視光増感色素により生成するカチオン重合開始源とラジカル開始源により、それぞれカチオン重合性不飽和化合物はカチオン重合し、重合性不飽和ビニル化合物はラジカル重合する2種の異なる重合反応が同時に、あるいは後加熱などの処理により重合が起こり、重合物あるいは架橋生成物を与える重合開始剤を含むことを特徴とする紫外線感光性組成物に関する。

#### [0002]

【従来の技術】カチオン重合性不飽和ビニル化合物(ビ 20 ニルエーテル化合物など)は、基材に対して接着性が良くなるなどのために、他のビニルモノマーと共重合させ接着剤として用られている。一般的には、ルイス酸系触 戦を用いて加熱重合法にて合成されている。

【0003】またアクリル系ピニルモノマー類は、光増感剤の存在下で紫外線重合あるいは紫外線硬化することは、既によく知られている。これは紫外線(UV)硬化インキなどに広く利用されている。これらUV硬化性あるいは重合性モノマーは、重合あるいは架橋時に非常に大きく収縮し、基材からの剥がれを生じる。またピニルス・デール化合物は、オニウム塩化合物の存在下で紫外線硬化あるいは重合することはP-E SUNDELL、S. JONSSON、and A. HULT: J. Polym. Scie. Polym. Chem. Ed., 29, 1525(1991)に報告されている。これは紫外線(400 nm以下の波長)を用いたジピニルエーテルの紫外線カチオン重合反応に関するものである。

【0004】この系は、光ラジカル重合性モノマー、光カチオン重合性モノマー、光重合開始剤オニウム塩化合物と溶剤にて構成されている。

# [0005]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、このような従来の光開始剤組成物や光感光性組成物が有する欠点を克服し、200~450nmの紫外線光の光に感応し、重合反応や光架橋反応を起こし基材やフィルムによく接着する、あるいは硬化特性に優れた高感度な紫外線重合性あるいは紫外線硬化性組成物を提供することを目的としてなされた物である。

#### [0006]

【課題を解決するための手段】本発明者は、以上の諸点 タンメタアクリレート、ポリエーテルメタアクリレー を考慮し、上記目的を達成すべく鋭意検討した結果、本 50 ト、ポリオールメタアクリレート、メラミンメタアクリ

発明に至った。

【0007】すなわち、第一の発明は、カチオン重合性不飽和ピニル化合物(A)、重合性不飽和ピニル化合物(B)、オニウム塩化合物(C)、及び光重合開始剤(D)からなる200~450nmの紫外線により光重合することを特徴とするである。以下に詳細に説明する

2

【0008】オニウム塩化合物(C)の光分解で生成したルイス酸により、カチオン重合性不飽和ビニル化合物(A)が、カチオン重合反応を引き起こし重合あるいは、架橋反応が起こる。

[0009] また光重合開始剤(D) とオニウム塩化合物(C) の光照射で生成するラジカルによるビニルモノマーのラジカル重合反応、カチオン重合反応がが起こり重合あるいは架橋が起こるものである。これは2種の異なる重合反応が同時あるいは同じ反応の場で起こることであり、新しいハイブリッドタイプ(複合型)の紫外線感光性組成物である。

【0010】カチオン重合性不飽和ピニル化合物(A) には、特に制限はなく、例えばエチレングリコールジピ ニルエーテル、エチレングリコールモノビニルエーテ ル、プロピレングリコールジピニルエーテル、プロピレ ングリコールモノビニルエーテル、ネオペンチルグリコ ールジピニルエーテル、ネオペンチルグリコールモノビ ニルエーテル、グリセロールジピニルエーテル、グリセ ロールトリピニルエーテル、トリメチロールプロパンジ ビニルエーテル、トリメチロールプロパンモノビニルエ ーテル、トリメチロールプロパントリビニルエーテル、 ジグリセロールトリビニルエーテル、ソルビトールテト ラピニルエーテル、アリルビニルエーテル、4 - ピニル エーテルスチレン、ハイドロキノンジピニルエーテル、 フェニルビニルエーテル、などのアリールビニルエーテ ル類や t - プチルビニルエーテルなどのアルキルビニル エーテル類でピニルエーテル基を有する化合物、あるい は水酸基をピニルエーテル変性したモノマーやポリマー 類、その他スチレン、α-メチルスチレン、ジピニルペ ンゼン、ポリプタジエンなどのジエン系ポリマー類、ビ ニルカルパゾールなどのカチオン重合性能を有するモノ マーあるいはポリマー類で単独あるいは数種類混合して 40 用いても差し支えない。

【0011】重合性不飽和ピニル化合物(B)としては、とくに制限はなく例えば、分子中にエチレン性不飽和結合を1個以上有するプレポリマーおよび(または)モノマーが使用される。プレポリマーの例としては、ポリエステルアクリレート、ポリエーテルアクリレート、ポリオールアクリレート、メラミンアクリレート、ポリエステルメタアクリレート、ポリエーテルメタアクリレート、ポリエーテルメタアクリレート、ポリエーテルメタアクリレート、ポリエーテルメタアクリレート、ポリオールメタアクリレート、メラミンメタアクリ

3

レート、不飽和ポリエステル樹脂、ポリプタジエン樹 脂、ポリペンテネマー樹脂等である。また、モノマーの 例としては、エチレングリコールジアクリレート、エチ レングリコールモノアクリレート、プロピレングリコー ルジアクリレート、プロピレングリコールモノアクリレ ート、1,6-ヘキサンジオールジアクリレート、ジエ チレングリコールジアクリレート、ネオペンチルグリコ ールジアクリレート、ジプロピレングリコールジアクリ レート、エチレングリコールジメタアクリレート、エチ コールジメタアクリレート、プロピレングリコールモノ メタアクリレート、ジエチレングリコールジメタアクリ レート、ジエチレングリコールモノメタアクリレート、 トリメチロールプロパントリアクリレート、トリメチロ ールプロパントリメタアクリレート、ペンタエリスリト ールトリアクリレート、ジペンタエリスリトールヘキサ アクリレート、その他のピニルモノマー類、例えばスチ レン、シクロヘキセン、ジピニルペンゼン、αーメチル スチレン、n-ヘキセン、アクリロニトリル、N-ビニ ルピロリドン、酢酸ビニル、ブタジエン類、その他ジエ 20 ン系ポリマー類、ポリプタジエン、ポリペンテネマー、 不飽和ポリエステル、不飽和ポリエーテル、不飽和ポリ ウレタン等の化合物などであり、単独あるいは混合して 用いても差し支えない。

【0012】オニウム塩化合物 (C) としては、一般に ルイス酸のオニウム塩を挙げることが出来る。ルイス酸 のジアゾニウム塩、ルイス酸のヨウドニウム塩、ルイス 酸のスルホニウム塩が用いられる。これらの化合物の一 例として四フッ化ホウ素のフェニルジアゾニウム塩、六 フッ化リンのジフェニルヨードニウム塩、六フッ化アン 30 チモンのジフェニルヨードニウム塩、六フッ化ヒ素のト リー4ーメチルフェニルスルホニウム塩、四フッ化アン チモンのトリー4ーメチルフェニルスルホニウム塩、ア セチルアセトンアルミニウム塩とオルトニトロベンジル シリルエーテル混合体、フェニルチオピリリウム塩、六 フッ化リンアレン-鉄錯体、でありこれに限定されるこ とはなく光反応にてルイス酸とラジカルを生成する化合 物であれば用いることが出来る。

> ジエチレングリコールジピニルエーテル 25部 トリメチロールプロパントリアクリレート トリフェニルスルフォニウムヘキサフルオロホスフェイト 5部 ベンゾフェノン ポリーN-ビニルカルパゾール ジオキサン

上記組成からなる感光液を50×50×2mmのガラス 板上に、感光液乾燥後の膜厚が10μmとなるように4 MILアプリケーターを用いて塗布し、乾燥後、ポリビ ニルアルコールにて表面処理を行い酸素保護層を形成さ せた後、感光板を作成した。オゾンレスタイプ紫外線照

ポリーメチルメタアクリレート

\*【0013】重合開始剤(D)としては、200~45 0 n mの波長の光を照射することによりラジカル重合す る光開始剤であれば用いることができる。代表例として は、ベンゾインエーテル系としては、例えばベンジル、 ベンゾイン、ベンジルアルキルケタノール、アセトフェ ノン系としては2-ヒドロキシ-2-メチルプロピオフ ェノン、p-t-プチルトリクロロアセトフェノン、p ジメチルアミノアセトフェノン、ペンゾフェノン系と してはペンゾフェノン、4 - クロロペンゾフェノン、o レングリコールモノメタアクリレート、プロピレングリ 10 -ペンゾイル安息香酸、4-4'-ジアルキルアミノペンゾ フェノン、チオキサントン系としてはチオキサントン、 2-クロロチオキサントン、2-アルキルチオキサント ン、その他として2-アルキルアントラキノンなどがあ るが、これらに限定する必要はなく、紫外線によるラジ カル重合反応が開始するものであればよく、またこれら 光重合開始剤を2種類以上混合して用いることができ る。本発明の感光性組成物には、必要に応じて通常の染 料、顔料、添加剤、樹脂化合物、禁止剤等や適当な希釈

> 【0014】本発明の感光性組成物の各添加量に関して は、光重合するに適した重量部であればよく、その量に 関しては特に限定するものでない。また本発明に関して 必要に応じて用いる希釈溶剤としては、紫外線感光性組 成物を溶解あるいは分散する溶剤であれば使用すること が出来る。

溶剤を加えても差し支えない。

【0015】本発明に必要に応じて用いる樹脂化合物と しては、ポリスチレン、アクリル樹脂、ポリカーポネー ト樹脂、ポリアクリロニトリル、ポリビニルカルパゾー ル、ポリピニルアルコール、ポリピニルクロライド、ポ リ酢酸ピニル、ナイロン樹脂、ポリエステル樹脂、その 他ポリエチレン、ポリプロピレンなどのポリビニル系ポ リマー類など溶剤、または水可溶または溶剤あるいは水 分散可能な樹脂なら用いることが出来る。

[0016]

【実施例】以下、本発明を実施例によって具体的に説明 するが、本発明はこの例に限定されるものでない。な お、例中「部」とは重量部を示す。

【0017】 実施例1

15部

5部

10部

400部

射装置にて80W/cm(1灯)、5/minの条件 で、紫外線照射し、照射後30分間100℃で後処理し た後ジオキサンで現像した結果、未反応部はほとんどな く、ガラス基板上に硬化フィルムがえられた。

【0018】実施例2

(東京化成工業(株)社製)

50部

イソシアヌル酸エチレンオキサイド変性トリ アクリレート

40部 (商品名アロニックスM-315、東亜合成化学社製) ジエチレングリコールジビニルエーテル 20部 チオキサントン 5部 ジフェニルヨードニウムヘキサフルオロホスフェート 5部 400部 ジオキサン

実施例1と同様にガラス板上に10μmの膜厚になるよ うに塗布乾燥後、オゾンレスタイプ紫外線照射装置にて 射し、照射後20分間120℃で後処理した後ジオキサ ンで現像した結果、不溶部が得られた。光硬化物は、ジャ

5

\*オキサン、トルエン、エタノールに不溶であった。この 場合はピニルエーテル基のカチオン重合とアクリルモノ 80 W/cm (1 ff)、5 /minの条件で、紫外線照 10 マーのラジカル反応が同時に反応の系内で起こったもの と推測できる。

【0019】実施例3

ジエチレングリコールジピニルエーテル 20部 10部 フェニルビニルエーテル エチレングリコールジアクリレート 20部 アロニックスM-315 40部 ミフィラーズケトン (ニッソキュア MAPB) 5部 ジフェニルヨードニウムヘキサフルオロホスフェート 5部

※でのライン照射し、露光後100℃の熱処理を行った 上記組成物を高速撹拌機で撹拌・混合して感光性組成物 を得た。得られた乾燥膜をピニルアルコールで酸素保護 20 後、現像を行うことによりより強固な硬化フィルムを得 ることができた。 膜を形成した後、この組成物を実施例2と同様に紫外線

照射装置にて80W/cm (1灯)、5/minの条件※ 【0020】実施例4 ジエチレングリコールジピニルエーテル ジビニルベンゼン

> アロニックスM-315 30部 ベンゾイルメチルエーテル(ニッソキュア MBO) 5部

> ジフェニルヨウドニウムヘキサフルオロホスフェート 5部 ピスフェノールーA-ジアリレート 10部

ポリーN-ピニルカルバゾール 20部 ポリメチルメタアクリレート (PMMA) 16部

ジオキサン 400部

上記感光性組成物を厚さ2mmの硬質ガラス板上にスピ ーナで乾燥後の膜厚 1 μmになるように塗布した。キセ ノンランプで365mmの波長の光を255mJ/cm 2 の露光量で照射しスポットパターン像を描いた後、1 20℃で30分間熱処理後ジオキサン溶液で現像処理 し、スポットパターン像を得る事が出来た。この場合は★ ★カチオン重合反応とラジカル重合が同時に起こることが 推察できるまたラジカル共重合とビニルエーテルのカチ オン単独重合が起こっていると推定されるが反応メカニ ズムは明確でない。

10部

5部

【0021】実施例5

ジエチレングリコールジピニルエーテル 30部 アロニックスM-315 30部 4、4'ジエチルアミノベンゾフェノン 5部 ジフェニルヨウドニウムヘキサフルオロホスフェート 5部 ポリメチルメタアクリレート 15部 トルエン 115部

上記感光性組成物をアルミ板の上に乾燥膜厚がスピーナ で5μmになるように塗布し、ポリビニルアルコールに て表面コートして乾燥後、365nmの波長のキセノン ランプでで露光量250mJ/cm²で1cm×1cm の面積に光照射後、現像処理後、得られたパターン像を 100℃で1時間熱処理するとジエチレングリコールジ ビニルエーテルが後硬化することにより膜に屈折差が生 50 起こる。

じ干渉縞が得られた。この場合はラジカル重合反応がま ず生じ後にカチオン重合が起こるものと推察されるが反 応メカニズムは明確でない。以上本発明は、カチオン重 合反応とラジカル重合反応が共存するハイブリッド(複 合) タイプの新しい可視光感光性組成物であり可視光 (200~800nmの波長領域)で硬化や重合反応が 7

# [0022] 比較例1

実施例1のジ(ジエチルアミノ)ケトクマリン色素を含まない組成物を、実施例1同じ条件にてキセノンランプ 照射した後、ジオキサンにて現像した結果すべて溶解してしまった。

# [0023]

[発明の効果] 本発明の感光性組成物は、200~450nmの紫外線波長に感応する感光組成物であり、ビニ

ルエーテルモノマー等のカチオン重合反応とビニルモノマーのラジカル重合反応が同時あるいは同じ系中で起こるハイブリッドタイブの新しい高感光性組成物である。 このため、ラジカル反応とカチオン反応の反応性の違いをうまくコントロールすることにより後処理することにより粘着性と接着性を持つ接着剤や粘接着剤への応用や、エンポス加工の分野にも提供される。

8